

HPLC/ GPC C - Oven 2002

Der HPLC/ GPC C - Ofen 2002 wurde konzipiert, um mehrere großvolumige HPLC / GPC—Säulen beheizen zu können.

Die Säulentemperatur kann schrittweise (1°C) zwischen der Raumtemperatur (RT plus 5°C) und maximal 200 °C eingestellt werden.

Die Steuerung des Ofens kann wahlweise manuell am Ofen selbst oder über die serielle RS232-Schnittstelle vorgenommen werden.



Technische Spezifikationen*

Temperatur - Arbeitsbereich	Raumtemperatur bis 200°C
Temperatur - Stabilität	± 0.1 °C
Temperatur-Reproduzierbarkeit	± 0.2 °C
Heizleistung	300 W
Digitale Temperaturanzeige	mit 0.1 °C Auflösung
Digitale Temperatureinstellung	mit 0.1 °C Auflösung
Einstellbarer Temperatur Cut Out	bis zu 20 °C über der Soll - Temperatur
Spannungsversorgung	220 V, 50 Hz
Interne Steuerung	über Tastatur am Gerät
Externe Steuerung	RS232 Schnittstelle
Gewicht	25 kg
Abmessungen Säulenofen Außenmaße	1000 mm x 210 mm x 210 mm (B x H x T)
Abmessungen Säulenwanne Innenmaße	650 mm x 100 mm x 100 mm (B x H x T)

*abhängig von der Gerätekonfiguration

Bestellinformation HPLC/ GPC C - Oven 2002

Artikel-Nr.:	Beschreibung:
C- 2002	HPLC/ GPC C - Oven 2002